

本功能使用Google Translate翻譯軟體，其翻譯結果僅供參考，本局不保證其翻譯結果之準確、完整或適用於特定目的。

This translation is machine-generated by using Google Translate. The translation is for reference. TIPO does not guarantee the translation is accurate, complete, reliable or fit for specific purposes.

DTD版本：1.0.0

發明專利說明書

※申請案號：094125332

※IPC分類：

一、發明名稱：

專利品質及公司技術強度之評估方法及其儲存媒體物

Qualifying a Patent and a Company Technical Strength Method and Medium Thereof

二、中文發明摘要：

本發明專利品質評估方法，先界定出各引用人之權值，並根據一專利被各引用人引用之次數以及對應之各引用人權值，藉以定義出此篇專利對引用人之影響值。接著，根據此專利在核准公開後在專利權存續期間之一特定週期中，每年受引用之狀況，藉以定義出此篇專利每年受引用之權值，並根據此篇專利每年受引用之權值來定義出此特定週期受引用之總權值。根據此總權值以及對引用人之影響值來定義出此篇專利之品質成績。若一公司於一特定品質成績之專利數量越多，則此公司之專利強度與技術強度越強。

三、英文發明摘要：

According to the present invention, the importance of the assignee citing this patent is weighted. The weighting values and the cited number of a patent by assignees are used to define the first parameter.. Next, the cited number of this patent in each year is weighted. Then, these weighting values are added to define a parameter. Finally, the quality level of this patent is defined according to the first parameter and the second parameter. If a company has a lot of qualified patents, this company has a stronger technology strength.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第2圖

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

六、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

[0001] 本發明是有關於一種評估方法，且特別是有關於一種專利評估之方法。

【先前技術】

[0002] 在知識經濟的時代中，企業保有競爭力的利器之一為專利建立、管理與應用。專利除可以使業者維繫其專屬之領域知識、避免受到競爭者模仿或侵犯之外，亦可透過專利銷售而創造收益。是故，在此產業發展趨勢下，如何評價一專利之品質實為產業經營的重要課題。

[0003] 由於專利權的獲准不僅有利於公司產品未來的銷售，尚可透過法律保障以維持其市場之利基，避免同業仿冒和抄襲，進而提升公司在市場的競爭能力。但是，以往之高科技廠商皆是一味地追求專利數量，對於所獲致專利之真正品質以及其與公司競爭力提升均間之關係均未加以評估，以致於常造成專利數量與公司競爭力間之落差。

[0004] 因此，傳統上發展出一現行影響指數（Current Impact Index, 簡稱CII）作為專利品質的衡量方法，揭露於美國專利第6,175,824號與美國專利第6,832,211號中。依照其定義，CII通常以某間公司某年（現行分析年）之前五年的專利每年平均被現行引用之頻率，例如1998年至2002年之專利，在2003年被引用之頻率，除上每年整體專利平均被引用頻率，所得之比值再乘以各公司每年專利數所佔的比重權值，來計算某公司某五年間專利技術的現行衝擊指數。就整體專利而言，CII期望值為1.00，若某公司某期間專利之CII=1.10，指該公司專利被引用的頻率高於平均的10%。接著，若欲計算此公司之技術強度(Technology Strength, TS)，則將所有專利核准件數乘上現行衝擊指數，便可得到經由「量」與「質」加權後的專利強度。

[0005] 然而，上述之評估方法存有一很大之缺陷，由於技術強度之估算是將所有專利核准件數乘上現行衝擊指數，並不再針對個別專利進行評估，造成每一件被核准專利所乘之權重，即現行衝擊指數均相同。換言之，既使某件專利之品質並不佳，其所獲致之權重亦等同於其他具優良品質之專利，造成了此公司之技術強度指標失真。

[0006] 因此，如何在公司技術強度指標之評量上，僅考慮到合於一定品質之專利，即成為追求之目標。

【發明內容】

[0007] 鑑於上述，傳統之公司技術強度評估指標在進行評估時，係將所有專利均乘上同一權值，但由於各篇專利彼此間之品質具有極大之差異性，如此評量方式會造成評估結果失真。

[0008] 因此，本發明之主要目的就是在提供一種專利品質評估方法，藉由加入一引用公司於此產業中之重要程度推算出專利品質。

- [0009] 本發明之另一目的是在提供一種根據專利核准後於其存續期間被引用之狀態，來評價專利品質之方法。
- [0010] 本發明之再一目的是在提供一種同時考慮引用人之重要性以及專利核准後於其存續期間被引用之狀態，來評價專利品質之方法。
- [0011] 本發明之又一目的是在提供一種藉由專利品質之評估結果來計算公司之技術強度。
- [0012] 根據一實施例，首先先界定出各引用人之權值，並根據一專利被各引用人引用之次數以及對應之各引用人權值，藉以定義出此篇專利之第一品質值。接著，根據此專利在核准公開後在專利權存續期間之一特定週期中，每年受引用之狀況，藉以定義出此篇專利每年受引用之權值，並根據此篇專利每年受引用之權值來定義出此特定週期受引用之第二品質值。根據此第一品質值以及第二品質值來定義出此篇專利之品質成績。
- [0013] 於本發明之另一實施例中，更包括義一專利之第三品質值，其中該第三品質值可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合。以及根據第一品質值、第二品質值以及第三品質值來定義出此篇專利之品質成績。
- [0014] 於另一實施例中，根據各專利之品質成績，對各篇專利進行排序。並設定一關鍵比例，其中排序在此關鍵比例內之專利定義為合於品質之專利。最後判斷特定公司於排序在此關鍵比例內所擁有之專利數，以及佔此公司核准專利之比例，藉此判斷出此公司之專利具有一定品質之比例。
- [0015] 於再一實施例中根據比例值、此公司的現行衝擊指數值以及於此技術領域中所擁有之總專利數，藉以定義出此公司之技術強度。
- [0016] 本發明於評估專利品質時，會同時考慮引用人之重要性以及專利核准後於其存續期間被引用之狀態，藉由使用客觀之外在條件來對一專利進行評價，因此可真實反映出一篇專利之真正價值。並根據一公司具一定品質專利佔其所有專利之比例，來評估一公司專利品質，並將合於品質之專利，用在評估一公司技術強度上，由整個評量過程，係根基在此公司之重要專利上，如此之評估結果，由於已剔除掉此公司非重要之專利，將可更加精確反應各產業中各公司之專利品質及其技術強度。

【實施方式】

- [0017] 根據本發明，評估一專利品質成績時所考量之參數包括有，引用人(ϕ)、每年之受引用次數(e)、專利存續期間每一年受引用次數之單次受引用權值(w)、專利之法律狀態(α)、專利被引用層數(β)、專利半衰期(γ)以及專利被引用之分佈狀態(δ)等。因此本發明之專利品質成績(G_s)評估式如下所示： $G_s = f(\phi) \times f(e) \times f(w) \times f(\alpha) \times f(\beta) \times f(\gamma) \times f(\delta)$ 值得注意的是，上述之參考參數僅為一基本參數，本發明專利品質成績評估式並不僅限於上述之參數。
- [0018] 參閱第1圖所示為本發明評估一專利品質時所使用之系統方塊圖，包括一專利資料庫101以及專利品質估算伺服器102。其中專利資料庫內存有多篇專利，以及與各篇專利相關之資料，這些相關資料包括有每一篇專利受引用次數、存續期間每一年受引用次數、受引用狀況（例如為第一層引用或第二層引用）、引用此篇專利之引用人為何、此篇專利之法律狀態以及專利被引用之分佈狀態等資料。專利品質估算伺服器102連接此專利資料庫101，可根據專利資料庫101內所儲存之各種專利資料進行計算，而得出上述之參數值。根據本發明，引用人參數(ϕ)係根據引用該篇專利引用人之重要性來界定此篇專利之品質。例如，就引用次數相同之兩篇專利而言，基於引用人之不同，實質上對這兩篇專利而言仍有品質差異存在。例如，以兩篇有關動態隨機存取記憶體之專利而言，若不考慮其他因素，而僅以專利引用人之重要性為考量，若第一篇專利皆為被如同美光、海力士等國際大廠所引用，而第二篇專利之引用人皆為不知名之小公司。在不考慮這些不知名的小公司引用了該專利，是否在往後會發展成創新技術而為新的業界標準的重要專利，而只單純考量目前眾所普遍認知的專利人重要性之前題之下，很明顯的，第一篇之重要性，亦即品質大於第二篇是無庸置疑的。
- [0019] 因此，本發明在評估一篇專利之品質時，亦將引用人之重要性亦併入考慮，亦即當定專利被一產業中主要公司引用次數越多，即表示此篇專利對此產業之影響力越大，當然其品質亦越佳。其中引用人之權值大小可由使用者根據其評估產業自行決定。例如於一實施例中，可根據引用人於此特定產業中所擁有之市佔率，來分配各引用人之權值，而此權值範圍可界於0至1中。當此引用人之權值決定後，本發明之品質估算伺服器102會從專利資料庫101中取出對應資料，例如，各引用人引用此篇專利之次數，計算出引用人參數(ϕ)。參閱下式為本發

$$f(\psi) = \prod \psi_{a,s}^{n_{a,s}}$$

明在計算引用人參數時所使用之式子：

- [0020] $\phi_{a,s}$ 為各引用人之權值， $n_{a,s}$ 為引用人引用專利S之總次數。
- [0021] 每年之引用次數(e)參數，係指此篇專利於核准公開後之存續期間，每年被他人引用之次數。
- [0022] 專利存續期間每一年受引用次數之單次受引用權值(w)。當一專利核准後，通常其單年被引用之次數會隨著所揭露技術之成熟而逐年增加，至一高峰後，隨著產業邁入成熟期，此專利單年被引用之次數亦逐年遞減。因此，專利單年之被引用次數分佈，通常如第2圖所示，類似一常態分配。另一方面，若一篇專利，一被核准公開後隨即被引用，或在被核准公開多年之後仍被引用，即可推論此篇專利在其所屬技術領域中為一重要之基礎專利，如第3圖所示，為專利核准公開後，被引用年與其專利重要性之關係圖。
- [0023] 換言之，如第2圖與第3圖所示，即使某一特定專利於核准公開初期，如圖中所示之A年，被他人引用次數很少，然，由於此為在專利權存續期間之初期階段即被引用，因此，即使引用次數很少，但這些引用次數應具有較高之單次引用權重。同理，在專利權存續期間後期，如圖中所示之B年，即使引用次數很少，但這些少引用次數卻彰顯出此篇專利之重要性，因此亦具有較高之單次引用權重。
- [0024] 因此，在計算一專利每年之單次受引用權值時，本發明之品質估算伺服器102會從專利資料庫101中取出此篇專利於一特定其間中每一年受引用次數之資料，並根據下式計算此篇專利之單次受引用權值(w)：

$$f(w) = \frac{E_{z,q}^{-1}}{\sum_{q=0} E_{z,q}^{-1}}$$

[0025] 其中， $E_{z,q}$ 為在 z 年被核准，而於 $(z + q)$ 年被引用之次數。

[0026] 專利之法律狀態(α)參數，係指專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況。以一專利而言，若其權利狀態常受他人挑戰，但此專利權利狀態仍穩固，則此專利於所屬技術領域中即屬一重要專利。然若其權利狀態現正處於受他人挑戰之情況，此時在評估此專利品質時，本發明藉由專利之法律狀態(α)參數，來調整此專利之品質權重評估。因此，根據本發明，當一專利之權利狀態遭受之質疑次數越多，但所受之質疑均不成立，則代表此專利之品質越佳，當然其相對之權值亦越高。

[0027] 專利被引用層數(β)參數，一專利在核准公開後，在其專利存續期間中，其被引用狀態，除了可能被直接引用外，亦可能會被間接引用，即受多層引用之情況。如第4圖所示，表示某一專利S分別被三篇專利直接引用，因此其第一層被引用之次數為3次。而引用專利S之三篇專利又分別被其他專利引用1次、1次和3次，此為專利S被間接引用，因此其第二層被引用之次數為5次，以此類推。

[0028] 若是只考量第一層的直接引用，則忽略了該專利被間接引用時所造成的影響。換言之，單考慮專利受直接引用次數，並不能完全彰顯出此篇專利之真正影響力，亦即其真正品質。因此本發明加入了引用層數的觀念，把第二層、第三層...等間接引用的關係也考量進去。由於，隨者引用層數之增加，此篇專利於受間接引用時之重要性亦隨之減少，因此引用層數權重隨層數增加而漸次降低。其評估算式如下所述：

$$f(\beta) = \frac{1}{i^2}$$

[0029] 其中， i 為被引用層數。

[0030] 專利半衰期(γ)參數。一般而言，一篇專利受引用之次數越多雖可推論出此篇專利之價值越高，但是隨著一篇專利之核准公開，其被引用之次數會隨著核准公開期間之增加而增加。因此若完全聚焦於專利被引次數來論斷專利品質，其判定出具優良品質之專利常為核准公開後已一段時間且被引次數多的專利，如此評估方法會忽略了新專利，以及引用專利與被引用專利間之關係。

[0031] 因此本發明引入一專利半衰期(γ)參數。亦即若被引用專利之核准公開時間與引用專利之核准公開時間，兩者間之時間差越大，即代表此受引用專利於公開後已一段時間仍受引用，因此此次之引用應具較大之權值。反之，若被引用專利之核准公開時間與引用專利之核准公開時間，兩者間之時間差很小，表示兩者是在技術相近年代，因此此次之引用應具較小之權值。藉由被引用專利之核准公開時間與引用專利之核准公開時間兩者間之時間差，以及此專利之受引用次數，來定義出此專利半衰期(γ)參數。得知專利之半衰期參數後，即可根據專利是在半衰期前被引用或在半衰期後被引用並配合年代因素，以調整專利權重。

[0032] 專利被引用之分佈狀態(δ)參數。基本上，專利被引用次數愈多，此篇專利則愈重要。但是同樣的引用次數卻仍有可能代表著不同的意義。例如，A專利是在第三年就被引用10次數；B專利在第十年才被引用10次。某A專利被引10次，但被引年份分佈平均；某B專利被引10次，集中在專利核准的前三年；某C專利被引用10次，但集中在專利核准的第十年之後。

[0033] 因此，本發明利用專利被引用之分佈狀態(δ)參數，來調整專利權重。例如，若專利在近年常常被引用時，認為其重要性較高，增加其權重。若年代較久遠之專利，雖其累積被引次數多，但近年被引次數少，認為不該因為其累積被引次數多而增加其權重。

[0034] 以下以一實施例說明上述專利品質評估之應用。

[0035] 例如，假設公司A與B均屬相同產業，其中專利S於1988年核准公開後，分別被公司A與公司B引用，其中公司A引用3次，公司B引用2次。其中若公司A與公司B分別為於此產業中市佔率排名第一與第二之公司。此時，若要評估專利S之品質，要考慮到引用人，即公司A與公司B之重要性。假設公司A與公司B所設定之重要性權值分別為0.5與0.4。此時本發明之品質估算伺服器102會從專利資料庫101中取出專利S受公司A與公司B之引用次數，並

根據公司A與公司B所設定之權值，計算出專利S之引用人參數 $f(\phi)$ ： $f(\phi)=0.5^3 \times 0.4^2 = 0.02$ 此外，若專利S於1998年被核准公開後，其被引用之情形如下表所示：

年	1998	1999	2000	2001	2002
引用次數	1	2	3	4	5

(e)					
-----	--	--	--	--	--

- [0036] 其核准公開後五年內，每一年受引用次數之單次受引用權值(w)，如下所示。其中於1998年，此篇專利S被引用一次，其對應權值為： $W(98,0)=1/1 \div (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5)=60/137$ 另假設專利S並未受任何權利瑕疵之質疑，且專利S所受之引用均為直接引用，因此其專利法律狀態 $f(\alpha)$ 以及專利被引用層數 $f(\beta)$ 均為1。此外，假設專利半衰期(γ)以及專利被引用之分佈狀態(δ)於此實施例中均不會對專利品質造成影響，因此專利半衰期 $f(\gamma)$ 權值以及專利被引用之分佈狀態 $f(\delta)$ 亦為1。
- [0037] 依此，即可一下式進行計算出本發明之專利品質成績(G_S)之計算。
- [0038] $G_S = f(\phi) \times f(e) \times f(w) \times f(\alpha) \times f(\beta) \times f(\gamma) \times f(\delta)$ 另一方面，若係在評估專利S於1998至2002年之五年期間之專利品質成績 G_S 時，其所使用之式子如下所示： $G_S = \sum [f(e) \times f(w)] \times f(\phi) \times f(\alpha) \times f(\beta) \times f(\gamma) \times f(\delta)$ 此時，品質估算伺服器102首先會計算此五年期間，每一年專利S被引用次數之總權重。例如，於2001年每一次的權重為15/137，總共被引用4次，2001年專利S被引用次數之總權重即為15/137 x 4。接著將五年期間每一年專利S被引用次數之總權重進行累加，並將累加結果與引用人參數、專利之法律狀態參數、專利被引用層數參數、專利半衰期參數以及專利被引用之分佈狀態參數相乘，獲致專利S之品質成績。
- [0039] 當完成各專利之品質成績計算後，即可將各專利依品質成績高低進行排序。接著設定一關鍵比例值，例如，根據本較佳實施例係取排序在前25%之專利，將其定義為高品質必要專利，然此關鍵比例值可由使用者根據所評估之產業進行調整。
- [0040] 由於排序在此關鍵比例值內之專利，係根據本發明之方法所評估出其專利品質成績核可之專利，因此若某一公司所申請之專利中具有較多排序在此關鍵比例值內之專利，即可推論出此公司於此技術領域中具技術領先之優勢，因此亦具較高之技術強度。參閱下式為本發明計算必要專利權值(EPI)時所使用之式子：

$$EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X} \quad (6)$$

- [0041] 其中 EPN_{ij} 代表一特定公司，例如公司i，在此項產業，如產業j中，排序在關鍵比例值(X)內所擁有專利篇數。 P_{ij} 則為公司i所發表有關產業j技術領域之總專利篇數。
- [0042] 由於此EPI值，係指一公司於一特定技術領域所發表之所有專利中，被認為具有一定品質之比例。因此當進行此公司之技術強度評估中，將引入此EPI值，其技術強度計算如下式所示： $ETS_{ij} = P_{ij} \times EPI_{ij} \times CII_{ij}$ 由於本發明在計算一公司之技術強度時，並非如傳統般係將衝擊指數(Current Impact Index, 簡稱CII)乘上所有專利，而不論此些專利之品質。而本發明在計算一公司之技術強度時，僅將符合一定品質程度之專利乘上衝擊指數，因此，在評估上，會優於傳統之技術強度指標，更貼合於實際狀況。
- [0043] 綜合上述所言，本發明提供一種專利品質評估方法，當在評價一篇專利時，同時考慮引用人之重要性以及專利核准後於其存續期間被引用之狀態，藉由他人使用此篇專利之情形，來推論出此篇專利之內涵品質。由於本發明係使用客觀之外在條件來對一專利進行評價，因此可真實反映出一篇專利之真正價值。
- [0044] 除此之外，本發明在評價一公司之技術強度時，並不基於公司所有已發表之專利「量」，而在於同時考慮專利「量」與專利「質」。易言之，本發明在評估一公司之技術強度時，其所考慮之專利，需達於根據本發明所界定出之專利品質，如此在評價上，由於已剔除掉不重要之專利對評價指標之影響，因此可獲得更精準之技術強度預估。
- [0045] 雖然本發明已以一較佳實施例揭露如上，然其並非用以限定本發明，任何熟習此技藝者，在不脫離本發明之精神和範圍內，當可作各種之更動與潤飾，因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

【圖式簡單說明】

- [0048] 第1圖所示為本發明評估一專利品質時所使用之系統方塊圖。
- [0049] 第2圖所示為專利單年之被引用次數分佈。
- [0050] 第3圖所示為專利核准公開後，被引用年與其專利重要性之關係圖。
- [0051] 第4圖所示為一專利被其他專利引用之階層關係圖。

【主要元件符號說明】

- [0046] 101．．．專利資料庫
- [0047] 102．．．專利品質估算伺服器

七、申請專利範圍：

1. 一種專利品質評估方法，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：定義各引用人之對應權值，其中該對應權值根據各引用人於一產業中所擁有之市佔率來決定；以該資料庫所儲存一專利被該些引用人引用之次數以及該各引用人之對應權值，由該伺服器定義出該專利之引用人參數，其中該伺服器定義出該專利之引用人參數係使用下式計算：

$$f(\psi) = \prod \psi_{a,s}^{n_{a,s}}$$

其中 $\psi_{a,s}$ 為一引用人之對應權值， $n_{a,s}$ 為一引用人引用該專利之總次數；以該資料庫所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用之次數，由該伺服器定義出該專利之引用狀態參數，其中定義出該專利之引用狀態參數更包括：以所儲存該專利核准後一特定時間內每年被引用之次數，定義出一單次引用權值，其中單次引用權值係使用下式計算：

$$f(w) = \frac{E_{z,q}^{-1}}{\sum_{q=0} E_{z,q}^{-1}}$$

其中 $E_{z,q}$ 為該專利在 z 年被核准，而於第 $(z+q)$ 年被引用之次數；以該專利每一年被引用次數以及每一年之單次引用權值定義出每一年總引用權值，其中每一年總引用權值係將該專利該年之單次引用權值乘上該專利該年之總引用次數；以及累加該特定時間內每一年之總引用權值以定義出該專利之該引用狀態參數，；以及該伺服器將該引用人參數乘上該引用狀態參數以定義出該專利之品質成績。

2. 如申請專利範圍第1項所述之方法，其中該專利每一年之單次引用權值與該專利每年被引用之次數成反比關係。
3. 如申請專利範圍第1項所述之方法，更包括使用該伺服器定義一其他參數，其中該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。
4. 如申請專利範圍第3項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數定義該專利之品質成績。
5. 如申請專利範圍第4項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數相乘。
6. 一種專利品質評估方法，係用以評估一公司之專利品質，該公司於一技術領域中具有至少一篇專利，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第1項定義出該技術領域中各專利之引用人參數、引用狀態參數以及對應之品質成績；以該些品質成績，由該伺服器排序該些專利；定義一關鍵比例值，並將排序在該關鍵比例值內之專利定義為合於品質專利；該伺服器計算該公司合於品質之專利數；以及以該公司合於品質之專利數，由該伺服器定義該公司於該技術領域中之必要專利權值，其中該必要專利權值係使用下式計算：

$$EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X}$$

其中 EPN_{ij} 為該公司於該技術領域中合於品質專利數， P_{ij} 則為公司於該技術領域中所擁有之總專利數。

7. 如申請專利範圍第6項所述之方法，更包括定義該技術領域中各專利之其他參數，其中該其他參數可為一專利之法律狀態品質、被引用層數品質、半衰期品質、被引用之分佈狀態品質或其上述組合，其中該專利之法律狀態參數，係指一專利存續期間其專利權利狀態受他人挑戰之情況；其中該專利之半衰期品質係指該專利之核准公開時間與引用該專利之一專利核准公開時間，兩者間之時間差。其中該專利之被引用之分佈狀態品質，係指該專利於公開後至到期前被引用之狀況。

8. 如申請專利範圍第7項所述之方法，更包括根據該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數定義該專利之品質成績。
9. 如申請專利範圍第8項所述之方法，其中定義該專利之品質成績係指將該引用人參數、該引用狀態參數以及該其他參數相乘。
10. 如申請專利範圍第6項所述之方法，其中該關鍵比例值可為專利品質成績大於一定標準內之專利。
11. 一種評估一公司技術強度之方法，係用以評估一公司在技術領域中所具有之技術強度，該方法係使用於一電腦系統中，其中該電腦系統包括一伺服器以及耦接該伺服器之一資料庫，包括：根據申請專利範圍第10項定義出該公司於該技術領域中之必要專利權值；計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由下式計算： $ETS_{ij} = P_{ij} \times EPI_{ij} \times CII_{ij}$ 其中 ETS_{ij} 為該公司於該技術領域中之技術強度值， EPI_{ij} 為該公司於該技術領域中之必要專利權值， P_{ij} 為公司於該技術領域中所擁有之總專利數， CII_{ij} 為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。
12. 一種電腦可使用媒體，其中儲存有一系列指令，當由一微處理器執行時，此微處理器可完成如請求項1所述之方法。
13. 如申請專利範圍第12項所述之媒體，更包括可執行下述程序：以品質成績排序專利；根據一關鍵比例值，定義合於品質專利；計算一公司合於品質之專利數；以及根據該合於品質之專利數定義該公司於一技術領域中之必要專利權值，其中定義該公司於該技術領域中之必要專利權值係由下式計算：

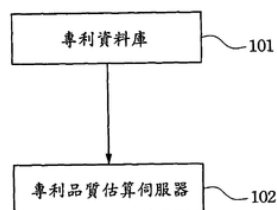
$$EPI_{ij} = \frac{EPN_{ij} / P_{ij}}{X}$$

其中 EPN_{ij} 為該公司合於品質之專利數， P_{ij}

則為公司於該技術領域中所擁有之總專利數。

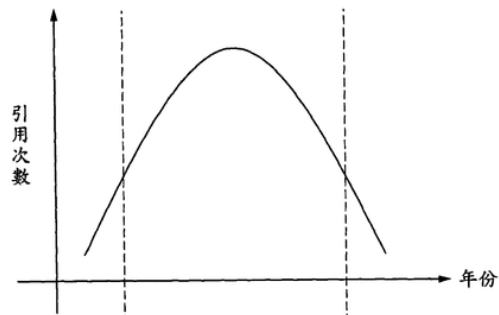
14. 如申請專利範圍第13項所述之媒體，更包括可執行下述程序：計算該公司之現行衝擊指數值以及該公司於該技術領域中所擁有之總專利數；以及根據該必要專利權值、該現行衝擊指數值以及該總專利數定義出該公司之技術強度，其中定義該公司之技術強度係由下式計算： $ETS_{ij} = P_{ij} \times EPI_{ij} \times CII_{ij}$ 其中 ETS_{ij} 為該公司於該技術領域中之技術強度值， EPI_{ij} 為該公司於該技術領域中之必要專利權值， P_{ij} 為公司於該技術領域中所擁有之總專利數， CII_{ij} 為該公司於該技術領域中之現行衝擊指數值。

八、圖式：

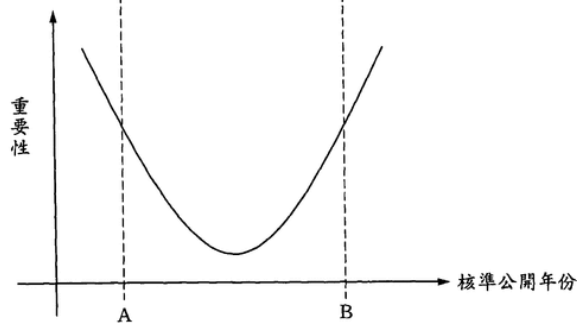


第 1 圖

第1圖

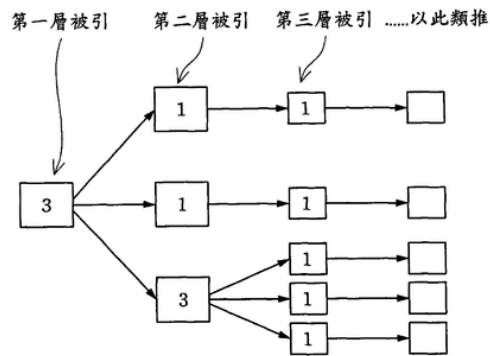


第 2 圖



第 3 圖

第2~3圖



第 4 圖

第4圖